05aE25P

2次元発光強度分布計測による超小型トカマク装置の 放電制御・高周波加熱に関する研究

Study of discharge control and RF heating characteristics in micro-tokamak device using 2-D photodiode array diagnostics

浜田 克紀¹, 福田 武司² Katsuki Hamada¹ Takeshi FUKUDA² 阪大工¹, 阪大院工²

Sch. of Eng., Osaka Univ.¹, Grad. Sch. of Eng., Osaka Univ.²

1. 超伝導装置に向けた低周回電圧着火・電流駆動

周回電圧の制限が予想される超伝導装置における放電 の最適化に寄与することを目的として、平衡解析コード TOSCA を援用して開発を行った超小型トカマク装置(ITER の約1/100 規模: R/a=6cm/2cm)[1]を用いた放電の最適化 研究を行なっている。図1に装置上面写真を示す。 2.45GHz wave



Triple probe 図1. 超小型トカマク装置上面写真

これまでの研究によりコイルにより作られる磁場はモ デル計算の結果とほぼ一致することを確認し[2]、電子サイ クロトロン加熱(ECH)を用いてプラズマ生成を行った結果、 共鳴層の位置がLFS 側にずれており、その原因として電子 バーンシュタイン波(EBW)励起の影響が推察されている[3]。 そこで、新たに2次元のフォトダイオードアレイを導入し、 発光強度分布とトリプルプローブを用いた2次元の電子密 度/温度の計測によって加熱特性を詳細に調べている。

2. 2. 45GHz 波を用いたプラズマ生成実験

Ar 中性ガス圧 3.40E-1 Pa で、R=54 mm において定常ト ロイダル磁場 44 mT になるよう設定し ECH (0.35 kW, X-mode)を入射すると、側面観測ポートからの[図2(a)] に示すように安定なトーラス状のプラズマを生成できる。 しかしながら、プローブを用いた温度・密度分布計測の結 果と比較すると図 2(b)に示すモデル計算と実測により求 めた 2nd-ECR(電子サイクロトロン共鳴層)の位置と異なっ ていると考えられることから、2 次元の発光強度分布計測 を用いて検証を進めている。



図2.トーラス放電の様子(a)とECR、UHR 位置(b)[3] 3.2次元光学系の整備・可動型トリプルプローブの改良 フォトダイオードアレイを用いた2次元発光強度分布測 定系と多チャンネル信号処理回路(図3)を製作してプラ ズマ生成・高周波加熱時の動的な変化を詳細に調べている。



図 3. フォトダイオード回路図

また、x-y-z 方向に可動である3次元マニピュレータに設置したトリプルプローブのプローブ面積を広げ、プローブ 電流の増大を図った。図4にその構成図と概要を示す。



図 4. 可動型トリプルプローブ

講演では製作した2次元のフォトダイオードアレイと可 動型トリプルプローブを用いた2次元の電子密度/温度計 測、共鳴位置およびEBW 励起の詳細な計測と検討、ECHの 入射角度変化などにより加熱特性を調べると共に、放電調 整を実施した結果について報告する。

- M. Inomoto, H. Nozato and T. Fukuda: Plasma Sci. Symp. / Symp. on Plasma Processing 22nd (2005) 497.
- [2] Y.Tanaka and T.Fukuda: Plasma Conference 2011 (2011) 24P139-P.
- [3] Y.Tanaka and T.Fukuda: Joint Symposium on Fusion Energy (2012), 28A-55p